+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Лазерный генератор изображений 4PICO PicoMaster 200

Image not found or type unknown

Производитель:

4PICO

Характеристики

Описание

Лазерные генераторы изображений 4PICO представляют собой универсальные лазерные генераторы изображений с ультравысокой точностью, специально разработанные для предоставления пользователю максимальной свободы создания микроструктур в фоточувствительных слоях. Принцип растрирования генератора обеспечивает равномерное экспонирование по всей поверхности. Сканирование подложки с высокой скоростью и шаговый привод экспонирующего модуля с программной регулировкой высоты делает MicroMaster 200 идеальным фотолитографическим инструментом для исследований, разработок, а также для опытного и мелкосерийного производства.

Ключевые особенности лазерных генераторов 4PICO серии PicoMaster:

- 4 режима экспонирования - 0,3 мкм, 0,6 мкм, 0,9 мкм, 5 мкм;
- Переключение режимов экспонирования в ПО установки, без смены объективов;
- Экспонирование одной топологии разными режимами в одном рецепте для увеличения производительности;
- Уникальная запатентованная конструкция экспонирующего модуля, позволяющая автофокусу моментально отрабатывать все неровности подложки;
- Экспонирование многослойных структур с совмещением по меткам;
- Полутоновое экспонирование;
- Возможность замены экспонирующего модуля на новый путем откручивания 4 винтов, без дополнительных настроек и калибровок (минимальное время простоя);
- Понятное и функционально насыщенное ПО, позволяющее при необходимости настроить процесс на самых глубоких уровнях.

Зависимость скорости экспонирования от минимального размера пятна

Разрешение	Скорость экспонирования при 50% наложении (normal quality)	Скорость экспонирования при 30% наложении (reduced quality)
0,3 мкм	1,7 мм^2/мин	2,6 мм^2/мин
0,6 мкм	3,4 мм^2/мин	5,3 мм^2/мин

0,9 мкм	5,2 мм^2/мин	7,7 мм^2/мин
5 мкм (опция)	29 мм^2/мин	43 мм^2/мин

Доступные опции:

- Замена источника излучения 405нм на источник с длиной волны 375нм;
- Модуль поддержания температуры и влажности в рабочем объеме генератора;
- Запасной экспонирующий модуль (375 нм или 405 нм на выбор).

Максимальный размер подложки	225x225 мм
Область экспонирования	200x200 мм
Разрешение	0,3 мкм, 0,6 мкм, 0,9 мкм, 5 мкм (выбирается в ПО)
Источник излучения	Диодный УФ лазер
Длина волны источника излучения	405 нм (опционально 375 нм)
Автофокус	Лазерный
Совмещение по меткам	Камера высокого разрешения
Защита от вибраций	Гранитное основание
Тип корпуса	Настольный
Вакуум	Внешний насос